(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平7-118365

(43)公開日 平成7年(1995)5月9日

(51) Int.Cl.6	識別記号	庁内整理番号	FΙ	技術表示箇所
C 0 8 G 59/14	NHE			
59/20	NHR			
CO8L 63/00	NJW			
C 0 9 J 163/00	JFM			
H01L 21/52	E			
			審査請求	未請求 請求項の数1 OL (全 5 頁)
(21)出願番号	特顯平 5-266190		(71)出願人	000002141
				住友ペークライト株式会社
(22)出顧日	平成5年(1993)10月25日			東京都品川区東品川2丁目5番8号
			(72)発明者	坂本 有史
				東京都千代田区内幸町1丁目2番2号 住
				友ペークライト株式会社内
			(72)発明者	鈴木 隆
				東京都千代田区内幸町1丁目2番2号 住
				友ペークライト株式会社内

(54) 【発明の名称】 ダイボンディング材

(57)【要約】

【構成】 下記式で示されるエポキシ樹脂(a)と分子 中に2個のフェノール性水酸基を含むフェノール類 (b) とを当量比 [(b) の水酸基当量/(a) のエポ キシ当量] で、フェノール類(b) の過剰下で反応して なる生成物、エポキシ樹脂、硬化剤及び無機フィラーを 必須成分とするダイボンディング材。

【化1】

【効果】 低応力性、接着性及び低吸水性に優れ、かつ 硬化時のプリードがなく工業的に有用なダイボンディン グ材である。

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 (A)式(1)で示されるエポキシ樹脂 (a) と分子中に2個のフェノール性水酸基を含むフェ ノール類(b)とを当量比[(b)の水酸基当量/ (a) のエポキシ当量]で、フェノール類(b) の過剰 下で反応してなる生成物、

* (B) エポキシ樹脂

- (C) 硬化剤 及び
- (D) 無機フィラー

を必須成分とすることを特徴とするダイボンディング 材。

【化1】

(ここでR₁, R₂: 2価の炭素数1~5の脂肪族基、又は炭素数6以上の

芳香族から2個の水素を除いた残基を示し、互いに同じあっても異なっていてもよい)

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、低応力性、接着性及び 低吸水性に優れたダイボンディング材に関するものであ る。

[0002]

【従来の技術】近年半導体チップの大型化、パッケージ の薄型化に伴い周辺材料である樹脂材料に対する信頼性 の要求は年々厳しいものとなってきている。その中でリ ードフレームに半導体チップを接着するダイボンディン グ材の特性がパッケージの信頼性を高める要因として重 要視されている。パッケージの信頼性で特に重要なもの として、実装時の熱ストレスに対する耐半田クラック性 がある。この特性を向上させるためには半導体封止材料 と同様にダイボンディング材にも低応力性、低吸水性、 高接着性が要求される。しかしながら、これまでこれら の特性を全て満足する材料は知られていなかった。例え ば、ダイボンディング材としてはポリアミド樹脂に無機 フィラーを分散させたものがあり、接着性、低応力性に 関しては優れているが、低吸水性の点で劣り、又溶剤を 用いるため硬化物中にボイドが残り易く、硬化に高温を※

※必要とするといった欠点があった。一方、他の樹脂とし てエポキシ樹脂に無機フィラーを分散させたものがある が、接着性に優れているものの、低吸水性の点でやや劣 り、又硬化物が硬く脆いため低応力性に劣るという問題 20 があった。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、これらの問 題を解決するため鋭意検討した結果、低応力性、接着性 及び低吸水性に優れたダイポンディング材を提供するも のである。

【課題を解決するための手段】本発明は、(A)式 (1) で示されるエポキシ樹脂(a) と分子中に2個の フェノール性水酸基を含むフェノール類(b)とを当量 比[(b)の水酸基当量/(a)のエポキシ当量]で、 30 フェノール類(b)の過剰下で反応してなる生成物、

- (B) エポキシ樹脂
- (C)硬化剤 及び
- (D) **無機**フィラー

を必須成分とするダイボンディング材である。

[0004]

【化2】

(ここでR1, R2:2価の炭素数1~5の脂肪族基、又は炭素数6以上の

芳香族から2個の水素を除いた残基を示し、互いに同じあっても異なっていてもよい)

【0005】本発明に用いる式(1)のエポキシ樹脂 は、低弾性率、低吸水性の特徴を有する。式中のRi, R2は2価の炭素数1~5の脂肪族基、又は炭素数6以 上の芳香族から2個の水素を除いた残基を示し、互いに 同じでも異なってもよい。 R_1 、 R_2 の2価の炭素数6以 50 (b)とを当量比 [(b)の水酸基当量/(a)のエポ

上のものは工業化されていない。これらの中でR1、R2 としてはプロピレン基が好ましい。本発明に用いる式 (1) のエポキシ樹脂とフェノール類(b) の反応例と しては、式(1)のエポキシ樹脂(a)とフェノール類

[0006]

3

キシ当量]で、フェノール類(b)過剰下、エポキシ樹脂とフェノール類(b)を混合し、必要により溶媒を加え100℃以上の条件で反応させる。当量比としては1~5がより好ましい。当量比が5を越えるとシロキサン含有量が少なくなり、ダイボンディング材としての低応*

CH-CH-CHO-R:-

0

mは1以上の整数

CH₁

-Si

CH.

CH

Si

CH₃ J₄m CH₃

【0007】しかし、式(2)の長鎖長のエポキシ樹脂、又は式(2)を用いた本発明の方法による反応生成物は低応力性に優れているものの接着強度、特に熱時強度が低下する。エポキシ樹脂(a)とフェノール類(b)との反応を促進するために、必要により触媒を添加してもよい。触媒の例としてはトリフェニルフォスフィン、トリプチルフォスフィン等の有機フォスフィン類、これらの有機ポレート塩、1,8-ジアザビシクロウンデセン等のジアザ化合物等が挙げられる。

【0008】本発明に用いるフェノール類としては、ハイドロキノン、レゾルシノール、ピスフェノールA、ピスフェノールF、ピスフェノールS、テトラメチルピスフェノールA、テトラメチルピスフェノールF、テトラメチルピスフェノールS、ジヒドロキシジフェニルエーテル、ジヒドロキシベンゾフェノン、oーヒドロキシフェノール、mーヒドロキシフェノール、pーヒドロキシフェノール、ピフェノール、テトラメチルピフェノール、エチリデンピスフェノール、メチルエチリデンピスフェノール、シクロヘキシリデンピスフェノール等が挙げられ、これらは単独でも混合して用いてもよい。

【0009】本発明で用いるエポキシ樹脂の例としては、特に限定されないが、例えばピスフェノールA、ピスフェノールF、フェノールノボラックとエピクロルヒドリンとの反応で得られるジグリシジルエーテルで常温で被状のもの、ピニルシクロヘキセンジオキシド、ジシクロベンタジエンオキシド、アリサイクリックジエポキ 40シドーアジベイトのような脂環式エポキシ等が挙げられる。

【0010】本発明の硬化剤としてはダイボンディング 材のシェルフライフを損なわないものであれば、特に限 定はされない。例えば、ヘキサヒドロフタール酸無水 物、メチルヒドロフタール酸無水物、ナジック酸無水物 等の酸無水物、ノボラック型フェノール樹脂等のボリフ ェノール類、及びイミダゾール、ジシアンジアミド等の アミン系化合物が挙げられる。反応生成物、エボキシ樹 脂、硬化剤の配合比は特に限定されないが、エボキシ基 50 当量/エポキシ基と反応する活性基当量の比が1~10であり、かつ3者の合計重量中の反応生成物は30重量%以上であることが好ましい。当量比が10を越えたり、又は反応生成物が30重量%未満だとダイボンディング材としての低応力性が損なわれるからである。

【0011】本発明で用いる無機フィラーとしては、炭 20 酸カルシウム、シリカ、アルミナ等の絶縁フィラー、銀 粉、金粉、ニッケル粉、銅粉等の導電性フィラーが挙げ られ、用途によりこれらを複数混合してもよい。更に、 ニードル詰りを防止するため、これらの粒径は50μm 以下のものが好ましい。

【0012】本発明によると、式(1)で示される低鎖 長シロキサンユニットを含むエポキシ樹脂をフェノール 類と予め反応させることにより、ダイボンディング材と して適度な粘度の樹脂が得られ、硬化時に樹脂成分のプ リード、アウトガスによるチップや、その周辺の汚染も 極めて少なくすることができる。又、式(1)のエポキ シ樹脂は、低鎖長シロキサンユニットのため熱時におけ る流動性がある程度抑制され、熱時接着強度の低下も少 なくなる。更に、単に式(1)のエポキシ樹脂を単独、 又は式(1)のエポキシ樹脂と他のエポキシ樹脂を混合 したダイボンディング材では、硬化時にアウトガスやブ リードが発生し半導体周辺を汚染してしまうという欠点 がある。本発明の樹脂組成物は、反応生成物、エポキシ 樹脂、硬化剤及び無機フィラー、必要に応じて硬化促進 剤、顔料、染料、消泡剤、溶剤等の添加剤を予備混合 し、三本ロールを用いて混練し、ペーストを得て真空脱 泡することにより製造することができる。

【0013】反応生成物の製造例1

ピスフェノールF (水酸基当量100)100g、式(3)のエポキシ樹脂(エポキシ当量181)90gに、触媒としてトリフェニルフォスフィン0.5gを添加し180℃、2hr反応させた。この生成物を反応生成物(1)とする

[0014]

【化4】

【0015】反応生成物の製造例2

レゾルシノール(水酸基当量 55) 110g、式(3)のエポキシ樹脂 180gに、触媒としてトリフェニルフォスフィン0. 5gを添加し、180 $\mathbb C$ 、2hr 反応させた。この生成物を反応生成物(2)とする。

(エポキシ当量330)165gに、トリフェニルフォスフィン0.5gを添加し180℃、2hr反応させた。この生成物を反応生成物(3)とする。
10 【0016】

*ピスフェノールF100g、式(4)のエポキシ樹脂

反応生成物の製造例3 * 【化5】

(4)

【0017】以下本発明を実施例で具体的に説明する。 実施例1

エポキシ樹脂としてピスフェノールドエポキシ樹脂(エポキシ当量170)(以下BPFEPという)70g、希釈剤としてtープチルフェニルグリシジルエーテル(以下TGAという)30g、硬化剤としてジシアンジアミド(以下DDAという)1g、2ーフェニルー4ーメチルイミダゾール(2E4MIという)2g、反応生成物(1)150g、平均粒径3μmのフレーク状銀粉830gを配合し三本ロールで混練しダイボンディング材を調製した。このダイボンディング材を用い銀めっき付銅フレームに2×2mm角のシリコンチップを200℃、60分で硬化接着させ、300℃における熱時接着カをプッシュブルゲージで測定した。同様に15×6×0、3mm(厚さ)のシリコンチップを厚さ50μmの銀めっき付銅フレームに200℃、60分で硬化接着さ

せ、低応力性の尺度としてチップの長手方向を表面粗さ

② 計を用いて上下方向の変位の最大値を求めた。又、ダイボンディング材硬化物(200℃、60分で硬化)の弾性率及び85℃、85%RH下での飽和吸水率を測定した。更にプリード性を調べた。評価結果を表1に示す。
【0018】実施例2~4

表1の配合に従い、実施例1と同様にしてダイボンディング材を調整し、実施例1と同様の試験を行った。例定

結果を表1に示す。

【0019】比較例1~3

材を調製した。このダイボンディング材を用い銀めっき 表1の配合に従い、実施例1と同様にしてダイボンディ 付銅フレームに $2 \times 2 \operatorname{mm}$ 角のシリコンチップを $2 \cdot 0 \cdot 0$ ング材を調整し、実施例1と同様の試験を行った。測定 \mathbb{C} 、 $6 \cdot 0$ 分で硬化接着させ、 $3 \cdot 0$ 0 \mathbb{C} における熱時接着 結果を表1に示す。

[0020]

【表1】

7

.

					•	
	表	1				
実施例				比較例		
1	2	3	4	1	2	3
70	70	70	70	70	70	70
30	30	30	30	30	30	30
1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2
150	100					
		150	100			
					120	
						75
						75
830	570	830	570	340	740	830
1050	950	1200	1100	670	360	1000
35	48	28	3 2	8 5	3 5	40
240	280	180	200	600	190	230
0.12	0.15	0.10	0.11	0.35	0.10	0.10
なし	なし	なし	なし	なし	なし	あり
	70 30 1 2 150 830 1050 35 240 0.12	表記 1 2 70 70 30 30 1 1 2 2 150 100 830 570 1050 950 35 48 240 280 0.12 0.15	1 2 3 70 70 70 70 30 30 30 1 1 1 2 2 2 2 150 100 150 830 570 830 1050 950 1200 35 48 28 240 280 180 0.12 0.15 0.10	実施例 1	実施例	実施例 比較例 1 2 3 4 1 2 2 70 70 70 70 70 70

【0021】 性に優れ、かつ硬化時のプリードがなく工業的に有用な【発明の効果】本発明は、低応力性、接着性及び低吸水 20 ダイボンディング材である。